理化学研究所 RI ビームファクトリーにおける チャージストリッパー

龍頭 啓充*

Charge strippers in RIKEN RI-beam factory

Hiromichi RYUTO*

はじめに

重イオンを高いエネルギーまで加速するためにはイ オンが高い荷電状態にある事が重要である. チャージ ストリッパーはイオンから電子を剥ぎ取りイオンの価 数を高める装置である. イオンの速度が大きいほど平 衡電荷が高いので、複数の加速器を用いて重イオンを 高いエネルギーまで加速する重イオン複合加速器施設 においては、それぞれの加速器間にチャージストリッ パーを置き電子を剥ぎ取る事により特に効率の良い加 速を行う事が出来る.理化学研究所 RI ビームファク トリー(RIBF)は昨年度稼動した重イオン複合加速 器施設である. RIBF は4台のリングサイクロトロン と、理研重イオンリニアック(RILAC)及びAVFサ イクロトロンの2台の入射器で構成されている¹⁾.本 レポートでは RILAC 入射に限って議論する.図1に RIBFの模式図を示す.4台のリングサイクロトロン のうち理研リングサイクロトロン(RRC)は約20年 間使用されてきたサイクロトロンであり, RILACの 直後における加速に用いられる.残り3台のリング サイクロトロンは新設された. それらは上流側から固 定周波数リングサイクロトロン (fRC), 中間段リン グサイクロトロン (IRC) 及び超伝導リングサイクロ トロン (SRC) である. イオン源から引き出された 重イオンビームは RILAC, RRC の順に加速され,ウ ラニウム等重いイオンはその後 fRC で加速され, IRC で加速された後に最終的に SRC で加速される. 軽いイオンは RRC で加速された後 fRC を用いずに直 接 IRC に送られる.チャージストリッパーは前半3



図1 理化学研究所 RI ビームファクトリーの模式図. 加速器とチャージストリッパーの配置を示す.

台の加速器である RILAC, RRC 及び fRC の下流に 設置されている.以下に RIBF で加速される典型的 なビームである²³⁸U のチャージストリッピングに関 して議論する.

チャージストリッパーに関する パラメーターの予測

新設されたリングサイクロトロンの設計にあたって は、加速するイオンの価数を決める必要があった.ま たチャージストリッパーによるエネルギー損失を考慮 して入射及び取出しエネルギーを決める必要があっ た.このためにチャージストリッパーの厚さを決める 必要があった.ところが RIBF で加速予定であった

^{*} 理化学研究所仁科加速器研究センター, RIKEN Nishina Center 現所属:京都大学大学院工学研究科附属光・電子理工学教育研究センター Photonics and Electronics Science and Engineering Center, Kyoto University (E-mail: ryuto@kuee.kyoto-u.ac.jp)

ストリッパー位置	第1ストリッパー	第2ストリッパー	第3ストリッパー
エネルギー (MeV/nucleon)	0.67	11	51
厚さ (mg/cm²)	0.02	0.5	14
価数	35+	72+	88+
割合	12%	19% (data)	34% (calc.)

表1 チャージストリッパーに関するパラメーターの予測値

典型的なビームである²³⁸Uに関するデータは限られ ていた.そこで以下に述べる種々の方法で荷電分布と チャージストリッパーの厚さを予測した.**表1**にチ ャージストリッパーに関するパラメーターの予測値を 示す.

第1ストリッパーはイオン源から取り出されたウ ラニウムイオンの電子を RILAC による加速の後 RRC で加速可能な最小の価数である 35 価まで剥ぎ取 る目的で用いられる. チャージストリッパーへの入射 エネルギーは 0.67 MeV/nucleon である. このエネル ギーにおける荷電分布のデータは見つからなかった が、荷電分布の表が島等2)によって与えられているの でこれを用いて予測した. またチャージストリッパー の厚さについては Baron の半経験式³⁾を用いて予測し た. その結果厚さ 0.02 mg/cm² の炭素膜を用いると 12%の割合で35価を得る事が出来るという予測にな った. 第2ストリッパーは RRC を用いて 11 MeV/ nucleon まで加速したウラニウムイオンの電子を次の 加速器である fRC で加速可能な価数まで剥ぎ取る目 的で使用される. 第2ストリッパーへの入射エネル ギーにおいては幸い GSI の 11.4 MeV/nucleon にお ける荷電分布のデータ4)が有ったのでこれを用いて予 測した.炭素膜の厚さについてはGSIで用いられた 厚さを採用することにした. 第3ストリッパーは fRC で加速したウラニウムイオンの電子を下流に設 置された IRC と SRC の2 台のリングサイクロトロン で加速可能な価数まで剥ぎ取る目的で使用される.こ のエネルギーにおけるデータは見つからなかったの で、荷電分布及びそれを得るために必要なチャージス トリッパーの厚さについて GLOBAL 計算4)を用いて 予測した. GLOBAL 計算の妥当性については,既存 加速器施設で加速可能な Kr 等のイオンの荷電分布を 第3ストリッパーへの入射エネルギーに近いエネル ギー領域において測定し、十分に厚い膜を用いた場合 は計算がデータを良く再現することを確認した5).炭 素膜の寿命については Baron³⁾や Livingston 等⁶⁾の半 経験式を用いて見積もった. 以下それぞれのチャージ



 図 2 0.67 及び 0.87 MeV/nucleon における厚さ 0.02 mg/cm²の炭素膜による ²³⁸Uの荷電分布. 横軸 は価数,縦軸は和を1に規格化した時の割合を 示す. 丸と三角はそれぞれ 0.67 及び 0.87 MeV/ nucleon における測定値,実線と破線はそれぞれ 0.67 及び 0.87 MeV/nucleon における荷電分布を 文献²⁾中の表から求めたものを示す.

ストリッパーについて述べる.

第1ストリッパー

RRC を用いて²³⁸U イオンを 11 MeV/nucleon まで 加速する場合に用いることが出来る最小の価数は35 価である.ところが RIBF コミッショニングの初期 においてはイオン源で35価のウラニウムイオンを生 成する事が出来なかったので、イオン源からは14価 のイオンを引き出し、第1ストリッパーを用いて35 価まで電子を剥ぎ取った. 最適な膜厚を決定するため に厚さ0.01 mg/cm²から0.08 mg/cm²の炭素膜を用 いた場合の荷電分布を測定した.35価は平衡電荷よ りも高い価数であるので、炭素膜は十分平衡に達する 厚さを持たなければならないが、厚い膜はビームの質 を悪化させるので、必要十分な厚さを知る必要があっ た. その結果予測通り厚さ 0.02 mg/cm² の炭素膜を 用いると適当であることが分かった.図2に0.67及 び 0.87 MeV/nucleon における ²³⁸U の荷電分布を示 τ . 0.87 MeV/nucleon that Charge state multiplier⁷ δ 用いる場合のエネルギーに対応するがここでは詳述し ない. 島等の表による予想は良く測定値を再現してい る. ウラニウムビームが炭素膜を通過する際に失うエ ネルギーは上流側にある RILAC の加速エネルギーを 調整することにより, チャージストリッパーの下流側 で RRC の入射エネルギーになる様に補う. 第1スト リッパーに入射するウラニウムビームは3箇所のス トリッパーのうちで最もエネルギーが低く, 最もビー ム強度が大きいため炭素膜は短寿命であった. 現在で はイオン源から 35 価のイオンを取り出せるようにな ったので, 第1ストリッパーを用いずに直接 RRC に 入射している.

第2ストリッパー

RRCを用いて11 MeV/nucleonまで加速された35 価のウラニウムビームは、第2ストリッパーを用い てfRCで加速可能な価数まで電子を剥ぎ取られる. 設計時には厚さ0.5 mg/cm²の炭素膜を用いて72 価 まで電子を剥ぎ取る予定であったが、fRCの入射エ ネルギーがさらに厚い膜を使用できる様に余裕を持っ て設計されていたため、RIBFコミッショニングの初 期においては厚さ0.6 mg/cm²の炭素膜を用いた.と ころが、膜によるエネルギー広がりがエネルギースト ラグリングの計算値⁸⁾による予測値よりも大きかっ た.これに対処するために炭素膜の厚さに対する荷電 分布の最大値をとる価数の依存性を測定した結果、厚 さ0.3 mg/cm²の膜を用いると fRC で加速可能な最小 の価数である71 価において荷電分布が最大値をとる ことが分かった.図3に11 MeV/nucleonにおける



 図3 11 MeV/nucleon における²³⁸Uの荷電分布で最 大値をとる価数の炭素膜厚依存性. 横軸は炭素膜 の厚さ,縦軸は荷電分布の最大値をとる価数を示 す.

荷電分布の最大値をとる価数の炭素膜の厚さへの依存 性を示す.大きなエネルギー広がりの原因については まだ特定出来ていないが,現在のところ走査型電子顕 微鏡による膜断面の観察等により微視的な膜厚分布に よるものだと考えている.図4に11 MeV/nucleon における厚さ0.3 mg/cm²の炭素膜によるウラニウム の荷電分布を示す.炭素膜は13 pnA 程度のビーム量



図4 11 MeV/nucleon における厚さ 0.3 mg/cm²の炭 素膜による ²³⁸U の荷電分布. 横軸は価数, 縦軸 は和を1に規格化した時の割合を示す.



図5 回転円筒ストリッパーの模式図.側面図と炭素膜 付近の拡大図を示す.

の時約6から12時間毎に交換される.

ビーム量増強に向けて炭素膜をアルミニウム製の円 筒の一端に貼り付けて回転させる,回転円筒ストリッ パーを製作した⁹⁾.図5に回転円筒ストリッパーの模 式図を示す.炭素膜は内径 100 mm 長さ 120 mm の アルミニウム製の円筒の一端に貼り付けられる. 円筒 の外側には空冷用のフィンが設けられている. 円筒の 両端は中空構造をした磁性流体シール回転導入機に接 続され,回転導入機はそれぞれ角型真空槽の側面に設 置されている. ビームは円筒と回転導入機の内側すな わち真空側を通過し、中程に設置された炭素膜を通過 して電子を剥ぎ取られる.炭素膜上のビームスポット と回転中心軸の距離は 30 mm である. 円筒は大気中 に置かれたモーターにより最大 1000 rpm で回転させ られる.回転する膜の近くには膜から出る熱輻射を吸 収するための水冷された板が設置されている. この水 冷された板の表面には放射率を増すためにアルミナが 溶射されている.水冷された板は固定されていて回転 しない. 膜の前後における圧力差による膜の損傷を防 ぐために,角型真空槽はダクトで接続されている.現 在のところ膜の交換に40分程度の時間がかかり、膜 交換手順の単純化が課題となっている.厚さ 0.5 mg/ cm²の膜を500 rpm で回転し, 膜に損傷が無いこと を確認した.回転円筒ストリッパー以外にも液体膜ス トリッパー10)の応用も検討されている.

第3ストリッパー

fRC を用いて 51 MeV/nucleon まで加速されたウ ラニウムの電子は第3ストリッパーを用いて IRC 及 び SRC で加速可能な価数まで剥ぎ取られる.設計時 の GLOBAL 計算による予測は厚さ 14 mg/cm²の炭 素膜を用いてウラニウムの電子を88価まで剥ぎ取る というものであった. ところが実際にウラニウムビー ムを加速して荷電分布を測定してみると、平衡電荷は 86 価であった. 厚さ4 mg/cm² から 17 mg/cm² の炭 素膜を用いて測定した結果 10 mg/cm² ですでにほぼ 平衡に達している事が分かったが、厚い膜を用いる事 が出来る様に fRC の取り出しエネルギーが余裕を持 って高めに設計されているので,厚さ17 mg/cm²の 炭素膜を用いて86価まで電子を剥ぎ取りIRC及び SRCで加速することにした.図6に51MeV/ nucleon における厚さ 17 mg/cm²の炭素膜によるウ ラニウムの荷電分布を示す.厚い第3ストリッパー はウラニウムイオンに約1割のエネルギー損失をも たらす.大きなエネルギー損失をもたらすストリッ パー膜は膜厚の違いによって下流側のビームエネル



 図6 51 MeV/nucleon における厚さ17 mg/cm²の炭素膜による²³⁸Uの荷電分布. 横軸は価数, 縦軸 は和を1に規格化した時の割合を示す.



図7 回転軸ストリッパーの模式図.側面図と炭素円板 付近の拡大図を示す.

ギーに差異をもたらす.膜交換時に生じる事が予想さ れる第3ストリッパー下流でのビームエネルギーの 変化に対する調整を行うために,膜を最大60度まで 傾けて通過後のビームエネルギーを微調整する機能を 持った膜交換機を製作した¹¹⁾.現在までのところ第3 ストリッパーの炭素膜に交換の必要性は生じていない.

第3ストリッパーについてもビーム量増強のため にグラッシーカーボンの円板を回転させる回転軸スト リッパーを製作した⁹.図7に回転軸ストリッパーの 模式図を示す.内径20mm外径120mmのグラッ シーカーボン製の円板を銅製の軸に取り付ける.軸は

磁性流体シール回転導入機を介して大気中に設置され たモーターによって最大 3000 rpm で回転させられ る.回転中心軸とビームスポットの距離は52mmで ある.円板の交換には10分程度の時間を要する.回 転円板の高温部から発せられる熱輻射を吸収するため に,水冷された銅板に鑞付されたグラファイト板が円 板の近くに設置されている.計画されている最大ビー ム強度である3pµAのウラニウムビームを照射した 時のビームスポット付近の温度は ANSYS 計算によ ると1500度強であり炭素の融点よりも十分低い. ビームスポットは円板の近くに挿入される ZnS(Ag) ビームビューアーを用いて調整される. 真空槽はビー ムビューアー用の覗き窓の他に熱画像装置による温度 測定用に BaF2 製の覗き窓を備えている. この窓と赤 外線用の鏡を用いて 63 MeV/nucleon において 0.75 pµAのアルゴンビームを照射した場合の温度分布を 測定し、ANSYS を用いた計算と比較して計算の妥当 性を検証した.

まとめ

理化学研究所 RI ビームファクトリーにおいて複数 のチャージストリッパーを用いた重イオンビームの効 率の良い加速を実現するために以下の様な事を行っ た.加速に用いる価数とチャージストリッパーの厚さ を決定するために種々の厚さの膜を用いて荷電分布測 定を行った.大強度ビームに対応するために2種類 の回転ストリッパー及び液体膜ストリッパーを開発し た.また,エネルギー調整機能を持った膜交換機を製 作した.これらによりウラニウムビームを345 MeV/ nucleon まで加速し実験に供することが出来た.

謝辞

理化学研究所 RI ビームファクトリーで使用中の長 寿命炭素膜は主として長谷部裕雄氏によって製作され たものです.炭素蒸着装置の導入および製作技術に関 しては高エネルギー加速器研究機構の菅井勲氏にお世 話になりました.チャージストリッパーに関する装置 の開発は長谷部氏の他,横内茂氏,千葉利哉氏と共同 で行いました.福西暢尚氏,加瀬昌之氏,後藤彰氏及 び矢野安重氏との議論は非常に貴重でした.これらの 諸氏に感謝します.なお,膜交換機開発の一部は,農 林水産省「先端技術を活用した農林水産研究高度化事 業」の研究成果です.

参考文献

- 1) Y. Yano, Nucl. Instr. and Meth. B 261, 1009 (2007).
- K. Shima, N. Kuno, M. Yamanouchi and H. Tawara, At. Data Nucl. Data Tables 51, 173 (1992).
- 3) E. Baron, IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-26, 2411 (1979).
- C. Scheidenberger, Th. Stohlker, W. E. Meyerhof, H. Geissel, P. H. Mokler and B. Blank, Nucl. Instr. and Meth. B 142, 441 (1998).
- H. Ryuto, N. Fukunishi, H. Hasebe, N. Inabe, S. Yokouchi, O. Kamigaito, A. Goto, M. Kase and Y. Yano, Proc. 2005 Particle Accelerator Conference, Knoxville, USA, 2005, p. 3751.
- A. E. Livingston, H. G. Berry and G. E. Thomas, Nucl. Instr. and Meth. 148, 125 (1978).
- O. Kamigaito, M. Kase, N. Sakamoto, Y. Miyazawa, E. Ikezawa, N. Fukunishi, S. Kohara, M. Fujimaki, M. Hemmi, T. Chiba, Y. Chiba, H. Ryuto, A. Goto and Y. Yano, Rev. Sci. Instrum. 76, 013306–1 (2005).
- D. Guillemaud-Mueller, M. O. Lampert, D. Pons and M. Langevin, IEEE Trans. Nucl. Sci. 33, 343 (1986).
- H. Ryuto, H. Hasebe, N. Fukunishi, S. Yokouchi, A. Goto, M. Kase and Y. Yano, Nucl. Instr. and Meth. A 569, 697 (2006).
- H. Ryuto, T. Chiba, H. Hasebe, M. Kase and Y. Yano, Jpn. J. Appl. Phys. 43, 7753 (2004).
- H. Ryuto, H. Hasebe, N. Fukunishi, T. Abe, A. Goto, M. Kase and Y. Yano, Nucl. Instr. and Meth. A 581, 586 (2007).